甚高频等离子体增强化学气相沉积制备 微晶硅太阳电池的研究*

张晓丹*赵颖 高艳涛朱锋 魏长春孙 建王岩 耿新华 熊绍珍

(南开大学光电子薄膜器件与技术研究所,天津 300071)
(光电子薄膜器件与技术天津市重点实验室,天津 300071)
(南开大学光电信息技术科学教育部重点实验室,天津 300071)
(2004年7月15日收到,2004年12月15日收到修改稿)

采用甚高频等离子体增强化学气相沉积技术成功地制备了不同硅烷浓度和辉光功率条件下的微晶硅电池.电 池的 J-V 测试结果表明 :在实验的硅烷浓度和功率范围内 随硅烷浓度的降低和功率的加大 ,对应电池的开路电压 逐渐变小 ,硅烷浓度的不同对电池的短路电流密度有很大的影响 ,但功率的影响在实验研究的范围内不是很显著. 对于微晶硅电池 ,N 层最好是非晶硅 ,这是因为一方面可以降低对电流的横向收集效应 ,另一方面也降低了电池的 漏电概率 ,提高了电池的填充因子.

关键词:微晶硅太阳电池,甚高频等离子体增强化学气相沉积 PACC:8115H,8630J

1.引 言

微晶硅太阳电池和非晶硅/微晶硅叠层太阳电 池已成为当前光伏领域研究的热点^[1-3],国际上在 这方面的研究已经取得了阶段性的成果^[4,5].目前, 我们的实验室在这一领域也开展了相关的研 究^[6-9]但对于微晶硅太阳电池的研究和认识还不 是很深刻.本文围绕着影响材料晶化程度的硅烷浓 度和辉光功率两大工艺参数,采用甚高频等离子体 增强化学气相沉积(PECVD)技术制备了系列微晶硅 太阳电池,并详细分析了两大工艺参数的变化对电 池性能的影响.同时,就掺杂层对微晶硅太阳电池性 能的影响也进行了初步的研究.

2.实验

实验中所有电池都是在三室连续的 PECVD 系 统中制备.其中 P 腔室和 I 腔室电源的激发频率为 60 MHz,而 N 腔室电源激发频率则为 13.56 MHz.P 腔室、I 腔室和 N 腔室的电极间距分别为 2.25,2.0 和 2.0 cm.本文如没有特别指明,电池 P 层选择的条 件是 PI(P1的硅烷浓度为 0.5%,气压为 120 Pa,P2 的硅烷浓度是 P1 的 2 倍,气压为 100 Pa).I 层硅烷 浓度为 3%—6%,功率变化为 9—26 W.为了研究非 晶 N 层和微晶 N 层对电池性能的影响,实验同时制 备了这两种 N 层的电池.所有电池的 P 层、I 层和 N 层的厚度分别为 20,1000和 20 nm 左右.实验所用的 衬底为 ZnO/SnO₂ 复合膜.电池的 J-V 特性测试所用 光强为 AM1.5(100 mW/cm²).电池的晶化率通过拉 曼光谱测试计算得到.拉曼光谱测试采用的是波长 为 632.8 nm 的氦氖激光器.

3. 结果和讨论

3.1. 硅烷浓度对微晶硅太阳电池性能的影响

图1给出了不同硅烷浓度条件下制备微晶硅太 阳电池的性能参数.从图1可以看出 随硅烷浓度的 逐渐增大,电池的短路电流密度逐渐变小,而开路电

^{*} 国家重点基础研究发展规划(批准号:G2000028202,G2000028203)教育部国际科技合作项目(批准号:2002DFG00051)和国家高技术研究 发展计划(批准号:2002AA303261)资助的课题。

[†]E-mail :xdzhang@nankai.edu.cn

压则逐渐增加.这是因为随硅烷浓度的逐渐增大,制 备硅薄膜材料的结构逐渐从微晶向非晶转变¹⁰(见 图 2).从图 2 能够明显看出,随硅烷浓度的逐渐增 大电池的晶化率⁷¹逐渐降低,当硅烷浓度为6%时, 电池拉曼测试结果表明电池完全是非晶硅,其晶化 率为零.另外,电池的填充因子随硅烷浓度的增大而 相对变大一点.这是因为:硅烷浓度越大制备电池中 非晶成分就越多,使得电池漏电减少,从而并联电阻 相对增大,表现为填充因子增大.实验发现,硅烷浓 度为6%条件下制备电池的效率最低,其原因是电 池中非晶成分较多,电池的短路电流密度太小.







图 2 不同硅烷浓度条件下电池的开路电压和晶化率

图 3 给出了不同硅烷浓度条件下制备电池的量 子效率(QE)测试结果.从QE曲线中可明显看出:硅 烷浓度为 5%条件下制备的电池在长波方向有一突 起,这表明此工艺条件下制备的是微晶硅电池,而硅 烷浓度为6%条件下制备的则是非晶硅电池.



图 3 不同硅烷浓度条件下制备电池的 QE 曲线

3.2. 辉光功率对微晶硅太阳电池性能的影响

图 4 给出了不同辉光功率条件下两个不同 P 层 制备微晶硅太阳电池的性能参数,从图4可以看出, 随功率逐渐增大,电池的效率先增大然后逐渐减小, 这说明在其他工艺条件确定的情况下 辉光功率对 电池性能也有一定的影响,我们具体分析了与电池 效率相关的三个参数,首先看填充因子,从图4可看 出 随辉光功率的增大,填充因子变化不是很明显, 都在 50% 左右,这样低的填充因子说明电池的各个 界面情况不是很好,通常微晶硅太阳电池的 I 层存 在纵向不均匀性 随厚度的增加薄膜的晶化率也逐 渐增大^{9]}.如果电池的 N 层是微晶硅材料,则在晶 化程度很高的 I 层基础上, 电池 N 层的晶化率会更 高,这样电池的 N 层表面可能会有一些空洞或晶粒 间界 这种电池就很容易后氧化 从而表现为在环境 中自然衰退,而且由于微晶硅材料中会存在一定的 缺陷、空洞等 使得制备的电池由于并联电阻小而导 致电池的填充因子低,电池的电流密度也随辉光功 率发生了变化.对于 P 层为 P1 条件的系列电池,当 功率较小(9W)和较大(26W)时, 电池的电流密度相 对都小一些;而当功率在12-14 W时,电池的电流 密度则比较大,而对于 P2 系列电池,比较大的电流 密度是出现在当辉光功率为 11—13 W 之间,另外值 得注意的是辉光功率与电池开路电压的关系,从图 4 可看出 随功率逐渐增大电池的开路电压逐渐降 低,这是由于加大功率增加了等离子体中氢原子数 量、氢原子的刻蚀使得材料逐渐由非晶向微晶转变, 结果表现为开路电压逐渐变小.

图 5 给出了三个不同辉光功率条件下制备电池



图 4 不同功率条件下制备电池的各个性能参数

的 QE 测试结果(P1 条件).从图 5 可以看出,低功率 (9 W)和高功率(26 W)条件下制备电池的长波响应 都不如中等功率(12 W)条件下制备的电池.这也说 明为获得高效率的微晶硅电池,在其他条件确定的 情况下,功率过低和过高都不好.因此,需要选择合 适的辉光功率范围.





3.3.N 层对微晶硅太阳电池性能的影响

掺杂层(这里主要研究 N 层)对微晶硅太阳电 池也有很大的影响.图6给出了相同的 I 层条件下, 选取不同 N 层制备微晶硅太阳电池的 *J-V* 特性曲 线.从图6曲线中可明显看出,当 N 层为微晶硅时, 制备电池的短路电流密度较大,而当 N 层为非晶硅 时,制备电池的短路电流密度相对较小,这可能是由 于 N 层为微晶硅时的横向收集效应引起的.另外, 从图 6 也可看出,电池的并联电阻有所提高.这说明 在制备微晶硅太阳电池时,N 层最好选用非晶硅材 料,这样在电池并联电阻得以改善的同时也会降低 电池电流的横向收集.



图 6 不同 N 层条件下制备电池的光态 J-V 曲线

图 7 给出了不同 N 层条件下制备电池的暗态 *J-V* 曲线.从图 7 可看出,与非晶硅 N 层电池相比, 微晶硅 N 层电池的 *J-V* 曲线在正偏压的低压端 (<0.1 V)明显偏离曲线的指数型拟合(如图中的直 线所示).这一偏离程度与电池 I/N 界面有很大的关 系.由于上述原因,在很大程度上导致微晶硅 N 层 制备电池的填充因子较小.



图 7 不同 N 层条件下制备电池的暗态 J-V 曲线

4.结 论

本文采用甚高频 PECVD 技术制备了不同硅烷 浓度和功率的系列微晶硅太阳电池.测试结果表明: 电池的开路电压随硅烷浓度的加大而增大,因为硅 烷浓度越大电池中的非晶成分越多,从而表现为开路电压变大.而短路电流密度却是随硅烷浓度加大而逐渐变小,这也是和材料的结构变化相一致的.电池的开路电压随辉光功率的增大而逐渐降低,其原

因是由于电池的晶化程度发生了变化,趋势是随着 晶化程度的提高电池的开路电压逐渐降低.另外,N 层如果为非晶硅则能明显提高电池的填充因子,降 低微晶硅太阳电池电流的横向收集效应.

- [1] Rech B, Roschek T, Repmann T et al 2003 Thin Solid Films 427 157
- [2] Kepper H, Meier J, Torres P et al 1999 Appl. Phys. A 69 169
- [3] Shah A V, Meier J, Vallat-Sauvain E et al 2003 Solar Energy Mater. Solar Cells 78 469
- [4] Ogawa K, Saito K et al 2001 Technical Digest of the International PVSEC-12 (Jeju: 12th International PVSEC Organizing Committee) p343
- [5] Yamamoto K, Nakajima A et al 2003 Proceeding of 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (Osaka :WCPEC-3

Organizing Committee)

- [6] Yang H D, Wu C Y et al 2004 Acta Ener. Solaris Sin. 25 127 (in Chinese)[杨恢东、吴春亚等 2004 太阳能学报 25 127]
- [7] Zhang X D, Zhao Y et al 2004 J. Optoelectronics · Laser 15 507(in Chinese)[张晓丹、赵 颖等 2004 光电子·激光 15 507]
- [8] Zhu F, Zhao Y et al 2004 J. Optoelectronics · Laser 15 381 (in Chinese)[朱 锋、赵 颖等 2004 光电子·激光 15 381]
- [9] Zhang X D, Zhao Y et al 2004 J. Syn. Cryst. 33 960 (in Chinese)[张晓丹、赵 颖等 2004 人工晶体学报 33 960]
- [10] Zhang X D , Zhao Y , Zhu F et al 2004 Chin . Phys. 13 1370

Study of microcrystalline silicon solar cells fabricated by very high frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition *

Zhang Xiao-Dan Zhao Ying Gao Yan-Tao Zhu Feng Wei Chang-Chun

Sun Jian Wang Yan Geng Xin-Hua Xiong Shao-Zhen

(Institute of Photo-electronics Thin Film Devices and Technique, Nankai University, Tianjin 300071, China)

(Key Laboratory of Photo-electronics Thin Film Devices and Technique of Tianjin , Tianjin 300071 , China)

(Key Laboratory of Opto-electronic Information Science and Technology of Ministry of Education , Nankai University , Tianjin 300071 , China)

(Received 15 July 2004; revised manuscript received 15 December 2004)

Abstract

Microcrystalline silicon solar cells with the variation of silane concentration (SC) and discharge power were fabricated by very high frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition. The results of J-V measurements showed that open circuit voltage (V_{oc}) of solar cells decreases with the decrease of silane concentration and the increase of power in the range of experiments. Influence of SC on short-circuit current density (J_{sc}) is more evident than power. As for microcrystalline silicon solar cells, the optimum choice for N layer is amorphous, because it can decrease the lateral collection effect of current on the one hand and increase the fill factor on the other hand.

Keywords : microcrystalline silicon solar cells , very high frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition PACC : 8115H , 8630J

^{*} Project supported by the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant Nos. G2000028202, G2000028203), International Science and Technology Cooperation Program of Ministry of Education, China (Grant No. 2002DFG00051), and the National High Technology Development Program of China (Grant No. 2002AA303261).